

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 17 年 9 月 29 日 (2005.9.29)

【公開番号】特開 2004-319558 (P2004-319558A)
【公開日】平成 16 年 11 月 11 日 (2004.11.11)
【年通号数】公開・登録公報 2004-044
【出願番号】特願 2003-107378 (P2003-107378)
【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 21/027

【F I】

H 0 1 L 21/30 5 6 3

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 5 月 11 日 (2005.5.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 1 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1 1】

請求項 9 又は 10 記載の基板処理装置において、
上記給気口及び排気口を、露光調整用気体の流れ方向に沿って複数に分割し、
分割された上記給気口の各給気口に、それぞれ切換手段を介して気体分子を含む露光調整用気体を供給し、

かつ、少なくとも露光調整用気体の流れ方向の両側部位の給気口に供給される気体分子の濃度を低く設定する、ことを特徴とする基板処理装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0019】

また、この発明の基板処理装置において、上記給気口及び排気口を、露光調整用気体の流れ方向に沿って複数に分割し、分割された上記給気口の各給気口に、それぞれ切換手段を介して気体分子を含む露光調整用気体を供給し、かつ、少なくとも露光調整用気体の流れ方向の両側部位の給気口に供給される気体分子の濃度を低く設定する方が好ましい（請求項 11）。